BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-279733

(43) Date of publication of application: 02.10.2003

(51)Int.Cl.

G02B 5/30 CO8G 64/08 GO2F 1/1335

(21)Application number: 2002-078596

(71)Applicant: TORAY IND INC

(22)Date of filing:

20.03.2002

(72)Inventor: ISHINABE RYOICHI

TAKANISHI KEIJIRO

SAKAMOTO TAKUO

(54) RETARDATION FILM AND RETARDATION PLATE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a retardation film with a high R value of 400 nm or 550 nm.

SOLUTION: The retardation film uses a resin comprising a recurring unit expressed by formula (1), a recurring unit expressed by formula (2), a recurring unit having a partial structure expressed by formula (3), and a recurring unit expressed by formula (4). In formula (1), R expresses an aliphatic hydrocarbon group or an aromatic hydrocarbon group with the carbon number of 1-20, X expresses oxygen, sulfur or selenium and phosphonate residuals with different R or X can be contained together. In formula (2), R' is selected from families independently comprising a hydrogen atom, a halogen atom, the aliphatic hydrocarbon group with the carbon number of 1-20, the aromatic hydrocarbon group with the carbon number 1-20 and a nitro group, and Y is selected from families comprising a single bond, an oxygen atom, a sulfur atom, an alkylene group and an alkylidene group, etc. In formula (3), R" is selected from

families independently comprising the hydrogen atom, the halogen atom, the aliphatic hydrocarbon group with the carbon number of 1-20, the aromatic hydrocarbon group with the carbon number of 1-20 and the nitro group.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

25.02.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-279733 (P2003-279733A)

(43)公開日 平成15年10月2日(2003.10.2)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ	•	ā	·-マコード(参考)
G 0 2 B	5/30		G 0 2 B	5/30		2H049
C 0 8 G	64/08		C 0 8 G	64/08		2H091
G02F	1/1335	5 1 0	G 0 2 F	1/1335	5 1 0	4J029

審査請求 未請求 請求項の数8 OL

OL (全 16 頁)

(21)出願番号	特顧2002-78596(P2002-78596)	(71)出願人	000003159
			東レ株式会社
(22)出願日	平成14年3月20日(2002.3.20)		東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号
		(72)発明者	石鍋 亮一
,			滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株
			式会社滋賀事業場内
		(72)発明者	高西 慶次郎
			滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株
·			式会社滋賀事業場内
		(72)発明者	坂本 卓夫
			滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株
			式会社滋賀事業場内

最終頁に続く

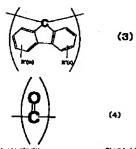
(54) 【発明の名称】 位相差フィルム及び位相差板

(57)【要約】

(修正有)

【課題】 高R値(R(400nm) ∕R(550nm))を持つ、位相差フィルムを得る。

【解決手段】 式(1)で示される繰り返し単位、式(2)で示される繰り返し単位、式(3)を部分構造として有する繰り返し単位、および、式(4)で示される繰り返し単位からなる樹脂を用いてなる位相差フィルム。



[式(1)中Rは炭素数1~20の脂肪族炭化水素基または芳香族炭化水素基、Xは酸素、硫黄あるいはセレンを表し、RあるいはXの異なるホスホン酸残基をともに含んでもよい。式(2)中R'は各々独立に水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~20の芳香族炭化水素基、ニトロ基からなる群から選ばれ、Yは単結合、酸素原子、硫黄原子、アルキレン基、アルキリデン基等からなる群から選ばれる。式(3)中R"は各々独立に水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~20の脂肪族炭化水素基、炭素数1~20の芳香族炭化水素基、炭素数1~20の芳香族炭化水素基、ニトロ基からなる群から選ばれる。]

【特許請求の範囲】

【請求項1】式(1)で示される繰り返し単位、式 (2) で示される繰り返し単位、式(3)を部分構造と して有する繰り返し単位、および、式(4)で示される 繰り返し単位からなる樹脂を用いてなる位相差フィルム・ であって、式(1)の繰り返し単位と式(4)の繰り返

し単位のモル分率が式(5)を満足したポリホスホネー トを含むものからなる位相差フィルムであり、400 n mおよび550nmおよび700nmの光線における位 相差(レタデーション値)が式(6)及び(7)を満足 することを特徴とする位相差フィルム。

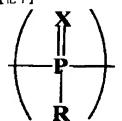
1. 20 < R(400 nm) / R(550 nm) < 2.00(6)

 \cdot 0. 60 < R(700 n m) / R(550 n m) < 0. 95 (7)

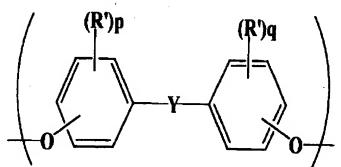
[式中、R(400nm)、R(550nm)、R(700n m)は、それぞれ光の波長が400nm、550nm、 700 nmにおける面内位相差である。]

【化2】

【化1】

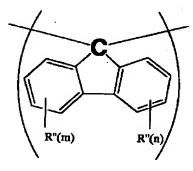


(1)



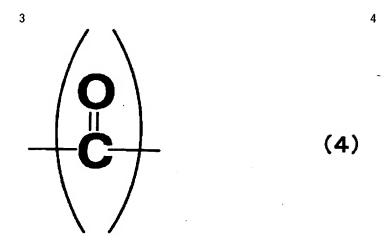
(2)

【化3】



(3)

【化4】



「式(1)中Rは炭素数1~20の脂肪族炭化水素基ま たは芳香族炭化水素基、Xは酸素、硫黄あるいはセレン を表し、RあるいはXの異なるホスホン酸残基をともに 含んでもよい。式(2)中R'は各々独立に水素原子、 ハロゲン原子、炭素数1~20の脂肪族炭化水素基、炭 素数1~20の芳香族炭化水素基、ニトロ基からなる群 から選ばれ、p、qはp+q=0~8の整数。Yは単結 合、酸素原子、硫黄原子、アルキレン基、アルキリデン 基、シクロアルキレン基、シクロアルキリデン基、ハロ 置換アルキレン基、ハロ置換アルキリデン基、フェニル アルキリデン基、カルボニル基、スルホン基、脂肪族ホ スフィンオキシド基、芳香族ホスフィンオキシド基、ア ルキルシラン基、ジアルキルシラン基、フルオレン基か

0. $90 > (c) / {(c) + (d)} \ge 0. 20$

[式(8)中、(c)は式(3)を部分構造として有す る繰り返し単位のモル数、(d)は式(2)の繰り返し 単位のモル数。]

【請求項3】 式(1)で示される繰り返し単位、式 (2) で示される繰り返し単位、式(3) を部分構造と して有する繰り返し単位、及び式(4)で示される繰り 返し単位からなる樹脂(E)と該樹脂(E)とは異なる 樹脂(F)からなるブレンド樹脂で構成される位相差フ ィルムであって、該フィルムの樹脂組成物において式

(3)を部分構造として有する繰り返し単位が樹脂組成

らなる群から選ばれる。式(3)中R"は各々独立に水 素原子、ハロゲン原子、炭素数1~20の脂肪族炭化水 素基、炭素数1~20の芳香族炭化水素基、ニトロ基か らなる群から選ばれ、m、nはm+n=0~8の整 数。]

 $1 \ge (a) / \{(a) + (b)\} \ge 0.05$ (5) [式(5)中、(a)は式(1)の繰り返し単位のモル 数、(b)は式(4)の繰り返し単位のモル数。] ^{*}

【請求項2】 式(3)を部分構造として有する繰り返 し単位のモル分率を (c)、式(2)で示される繰り返 し単位のモル分率を(d)とした時、式(8)を満足す ることを特徴とする請求項1に記載の位相差フィルム。

(8)

物中の30重量%以下であり、かつ樹脂(E)が式 (1) で示される単位と式(4) で示される繰り返し単 30 位のモル分率が式(5)を満足することを特徴とする請 求項1に記載の位相差フィルム。

【請求項4】 請求項1~3のいずれかに記載の位相差 フィルムにおいて、式(3)を部分構造として有する繰 り返し単位が、式(9)または/及び式(10)に記載 の繰り返し単位であることを特徴とする位相差フィル ム。

【化5】

【化6】

[式(9)、式(10)中R"は各々独立に水素原子、 ハロゲン原子、炭素数1~20の脂肪族炭化水素基、炭 素数1~20の芳香族炭化水素基、二トロ基からなる群 から選ばれ、m、nはm+n=0~8の整数。]

【請求項5】 ホスホン酸残基の代わりに一部ホスホナイト残基により構成され、その置換比率が50%以下であることを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の位相差フィルム。

【請求項6】 該フィルムのガラス転移温度が130℃ 20以上かつ220℃以下であることを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載の位相差フィルム。

【請求項7】 該請求項1~6のいずれかに記載の位相 差フィルムからなることを特徴とする位相差板。

【請求項8】 請求項7に記載の位相差板からなること を特徴とする円偏光板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置等に 用いられる位相差フィルムに関するものである。

[0002]

【従来の技術】液晶表示デバイスの分野で使用される光学フィルムとして、レターデーション値の比(R値)を液晶セルの構成(セルギャップ)に応じて好ましい値にするために、現在ポリビニルアルコール、ポリカーボネート、ポリアリレート等が用いられているが、Rの値を充分コントロールできないのが現実である。とくにSTN液晶表示装置の表示品位を向上させるために位相差フィルムが用いられている。

【0003】近年、STN、TFT液晶表示装置の表示 40品位を向上させるために、STN液晶表示装置の応答性を向上させる検討がなされているが、現在主に用いられているポリカーボネートの位相差フィルムのレターデーション値の比(R)ではRが1.15程度であるため、高速応答に対する表示品位が不充分であり、Rの値のより大きなものが望まれている。これらの課題を克服する方法として、2枚のフィルムを重ねて用いる方法(特開平3-13917号公報、特開平3-13916号公報など)が提案されている。しかし、前記の方法では、コストアップになること、また2枚のフィルムの重ね合わせ 50

の角度調整および接着などのプロセスなどが困難であること、さらに充分なRの値がえられないことなどの問題がある。

【0004】本発明の目的は、前記の従来の問題を解決するためになされたものであり、同一面内で充分なレターデーション値の比を有する位相差フィルムを提供することにある。

【0005】特開平6-179423号公報で、波長分散の大きい位相差フィルムについての記載があるが、本研究者らは、該フィルムはスルホン基等を有しているものもあり、延伸前から少し着色があることを確認した。また、延伸温度が高すぎることから加工性が悪く、さらにフィルムの延伸温度が高いため、延伸後のフィルムは着色がさらに悪化するなどの課題を確認している。またR値(R(400nm)/R(550nm))が最大で1.31であり、波長依存性もまだ十分でない。

【0006】本発明は、上記課題を解決するため、従来品よりも位相差フィルムのR値(R(400nm)/R(550nm))が大きく、かつ延伸温度の低い、無色透明な位相差フィルムの提供することである。

[0007]

30

【発明が解決しようとする課題】本発明者らは、前記問 題を解決するために鋭意研究を重ねた結果、特定の組成 のポリマーを用いることにより、1枚で特定の波長にお けるレターデーション値の比であるRの値を一定の範囲 でコントロールできる位相差フィルムを見出し、本発明 を完成するにいたった。すなわち、本発明は、ポリホス ホネートを含むものからの位相差フィルムであって、4 OOnmにおけるレターデーション値Re(400n m) と550 nmにおけるレターデーション値R(55 Onm) の比であるR値(R(400nm) /R(5 50 nm))が1.20~2.00であることを特徴 とする位相差フィルムに関する。近年、液晶表示装置の 表示品位向上のため液晶セルの高速応答化の検討が行わ れている。しかしながら、高速応答化された液晶セルは 大きな波長依存性をもつため、前記したような、ポリビ ニルアルコール、ポリカーボネート、ポリアリレート等 の位相差板では、表示品位が不十分であるなどの問題が あった。特開平6-179423号公報で、波長分散の

大きい位相差フィルムについての記載があるが、本研究者らは、該フィルムはスルホン基等を有してものもあり、延伸前から少し着色があることを確認した。また、延伸温度が高すぎることから加工性が悪く、さらにフィルムの延伸温度が高いため、延伸後のフィルムは着色がさらに悪化するなどの課題を確認している。R値(R(400nm)/R(550nm))が最大で1.31であり、波長依存性もまだ十分でない。

【0008】本発明は、上記課題を解決するため、従来品よりも位相差フィルムのR値(R(400nm)/R(550nm))が大きく、かつ延伸温度の低い、無色透明な位相差フィルムの提供することである。

[0009]

[0014]

【課題を解決するための手段】式(1)で示される繰り返し単位、式(2)で示される繰り返し単位、式(3)を部分構造として有する繰り返し単位、および、式

(4)で示される繰り返し単位からなる樹脂を用いてなる位相差フィルムであって、式(1)の繰り返し単位と式(4)の繰り返し単位のモル分率が式(5)を満足したポリホスホネートを含むものからなる位相差フィルムであり、400nmおよび550nmおよび700nmの光線における位相差(レタデーション値)が式(6)及び(7)を満足することを特徴とする位相差フィルム。

[0010]

1.
$$20 < R(400 \text{ nm}) / R(550 \text{ nm}) < 2.00$$
 (6)

10

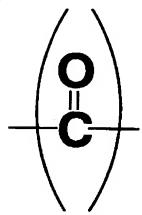
0. 60 < R(700 nm) / R(550 nm) < 0.95 (7)

[式中、R(400nm)、R(550nm)、R(700nm)は、それぞれ光の波長が400nm、550nm、700nmにおける面内位相差であり、以下このように呼ぶ。]

[0012] [化8]

【化10】

R"(m)



(4)

10

【0015】 [式(1)中Rは炭素数1~20の脂肪族 炭化水素基または芳香族炭化水素基、Xは酸素、硫黄あ るいはセレンを表し、RあるいはXの異なるホスホン酸 残基をともに含んでもよい。式(2)中R'は各々独立 に水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~20の脂肪族炭 化水素基、炭素数1~20の芳香族炭化水素基、二トロ 基からなる群から選ばれ、p、aはp+a=0~8の整 数。Yは単結合、酸素原子、硫黄原子、アルキレン基、 アルキリデン基、シクロアルキレン基、シクロアルキリ デン基、ハロ置換アルキレン基、ハロ置換アルキリデン 基、フェニルアルキリデン基、カルボニル基、スルホン 基、脂肪族ホスフィンオキシド基、芳香族ホスフィンオ キシド基、アルキルシラン基、ジアルキルシラン基、フ ルオレン基からなる群から選ばれる。式(3)中R"は 各々独立に水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~20の 脂肪族炭化水素基、炭素数1~20の芳香族炭化水素 基、ニトロ基からなる群から選ばれ、m、nはm+n= 0~8の整数。1

 $1 \ge (a) / \{(a) + (b)\} \ge 0.05$ (5) [式(5)中、(a)は式(1)の繰り返し単位のモル 数、(b)は式(4)の繰り返し単位のモル数。] [0016]

【発明の実施の形態】本発明の位相差フィルムは、以下 の構成を有するものである。

【0017】本発明者らは、前記問題を解決するために 鋭意研究を重ねた結果、特定の組成のポリマーを用いる ことにより、1枚で特定の波長におけるレターデーショ ン値の比であるR値を一定の範囲でコントロールできる 40 位相差フィルムを見出し、本発明を完成するにいたっ た。すなわち、本発明は、ポリホスホネートを含むもの

からの位相差フィルムであって、400mmにおけるレ ターデーション値R(400nm)と550nmにおけ るレターデーション値R(550nm) の比であるR (R (400 nm) / R (550 nm)、以後R値と 呼ぶ) が1. 20~2. 00であることを特徴とする 位相差フィルムに関するものである。

【0018】本発明は、式(1)で示される繰り返し単 位、式(2)で示される繰り返し単位、式(3)を部分 構造として有する繰り返し単位、および、式(4)で示 される繰り返し単位からなる樹脂を用いてなる位相差フ ィルムであって、式(1)の繰り返し単位と式(4)の 繰り返し単位のモル分率が式(5)を満足した樹脂から なる位相差フィルムからなり、式(3)で示したフルオ レン骨格を部分構造にもつ繰り返し単位と式(2)で示 した繰り返し単位の配合比によって、R値を1.2~ 2. 0の範囲でコントロールすることができる。なお、 式(2)繰り返し単位と式(3)を部分構造にもつ繰り 返し単位の比については式(8)の範囲を用いて、R値 をコントロールする事が可能であり、R値が式(6)か つ式(7)を満足した位相差フィルムを得た。

【〇〇19】本発明の位相差フィルムは正の複屈折率異 方性を持つものに、負の複屈折率依存性のものを含有さ せることによって、式(11)かつ式(12)、好まし くは式(6)かつ(7)を、最も好ましくは式(13) かつ式(14)の特性を得ることができる。なお、正の 複屈折率異方性をもつものは、フィルム延伸方向と面内 屈折率楕円体の長軸方向が同一方向であるのに対し、負 の複屈折率異方性をもつものは、フィルム延伸方向と面 内屈折率楕円体の長軸方向が直交方向になる。

[0020]

1. 20 < R(400 nm) / R(550 nm) < 2.00(11)

30

- 0. 75 < R(700 nm) / R(550 nm) < 0.95(12)
- 1. 20 < R(400 nm) / R(550 nm) < 1.50
- 0. 75 < R(700 nm) / R(550 nm) < 0.92(7)
- 1. 31 < R(400 nm) / R(550 nm) < 1.50(13)
- 0. 75 < R(700 nm) / R(550 nm) < 0.92(14)

本発明によれば、高R値特性を有する高分子配向フィル ムからなる位相差フィルムは、構成される部分構造が 50 によって得られるものである。

(A)または(B)の条件を満たす高分子配向フィルム

20

る。

11

[0021] (A)

(1) 正の屈折率異方性を有する高分子のモノマー単位 (以下、正モノマー単位という。) と負の屈折率異方性 を有する高分子のモノマー単位(負モノマー単位とい う。) とを含む高分子から構成されるフィルムであっ て、(2) 正のモノマー単位に基づく高分子のR(400nm)/R(550nm)は、負モノマー単位に基づく高分子のR(400nm)/R(550nm)よりも 小さく、かつ(3) 負の屈折率異方性を有する、高分子 配向フィルム。

[0022] (B)

(1) 正の屈折率異方性を有する高分子を形成するモノマー単位(以下正モノマー単位という。)と負の屈折率異方性を有する高分子を形成するモノマー単位(以下、第2のモノマー単位という。)とを含む高分子から構成されるフィルムであって、(2)正モノマー単位に基づく高分子のR(400nm)/R(550nm)は、負モノマー単位に基づく高分子のR(400nm)/R(550nm)よりも大きく、かつ(3)正の屈折率異方性を有する、高分子配向フィルム。

【0023】上記(A)(B)の条件を満たす態様の例 として、下記条件(C)(D)を満たすものがある。 【0024】(C)

(1) 正の屈折率異方性を有する高分子と負の屈折率異方性を有する高分子とからなるブレンド高分子及び/又は正の屈折率異方性を有する高分子のモノマー単位と負の屈折率異方性を有する高分子のモノマー単位とからなる共重合体から構成されるフィルムであって、(2)該正の屈折率異方性を有する高分子のR(400nm)/R(550nm)は該負の屈折率異方性を有する高分子 30のR(400nm)/R(550nm)よりも小さく、かつ(3)負の屈折率異方性を有する、高分子配向フィルム。

[0025] (D)

(1) 正の屈折率異方性を有する高分子と負の屈折率異方性を有する高分子とからなるブレンド高分子及び/又は正の屈折率異方性を有する高分子のモノマー単位と負の屈折率異方性を有する高分子のモノマー単位とからなる共重合体から構成されるフィルムであって、(2)該正の屈折率異方性を有する高分子のR(400nm)/ 40R(550nm)は該負の屈折率異方性を有する高分子のR(400nm)/R(550nm)よりも大きく、かつ(3)正の屈折率異方性を有する、高分子配向フィルム。

【0026】ここで、正又は負の屈折率異方性を有する 高分子とは、正又は負の屈折率異方性を有する高分子配 向フィルムを与える高分子をいう。

【 0 0 2 7 】 本発明のフィルムは、前記式 (1) ~ (4) の繰り返し単位からなる、位相差フィルムを構成する部分構造が、 (A) ~ (D) のいずれかの条件を満 50

12

たす高分子配向フィルムによって得られるものである。また、限定されるものではないが、負モノマー系である式(3)を部分構造に有する繰り返し単位と正モノマー系である式(2)の配合比によって、フィルムの屈折率異方性を正または負とすることができ、かつ位相差特性も、式(11)及び式(12)、更に好ましくは式(6)及び式(7)を満足し、最も好ましくは式(13)及び(14)を満足することができる。

【0028】式(1)で示される繰り返し単位、式(2)で示される繰り返し単位、式(3)を部分構造として有する繰り返し単位、および、式(4)で示される繰り返し単位からなる樹脂を用いてなる位相差フィルムであって、式(1)の繰り返し単位と式(4)の繰り返し単位のモル分率が式(5)を満足したポリホスホネートを含むものからなる樹脂(E)と異種樹脂(F)からなるブレンド高分子でも、本発明を適用することができ

【0029】すなわち、ブレンド高分子は上記条件の(C)または(D)のいずれかの条件を満足すれば、樹脂(E)には何種類の樹脂(F)をブレンドすることができるが、式(3)を部分構造として有する繰り返し単位重量%がブレンド高分子中で1~40重量%で用いられ、好ましくは1~30重量%未満であることが好ましく、最も好ましくは1~25重量%であり、位相差特性も、式(11)かつ式(12)、更に好ましくは式(6)かつ式(7)を満足し、最も好ましくは式(13)かつ(14)を満足することができる。

【0030】本発明におけるフィルムのブレンド高分子とは既知の樹脂を用いることが可能で、樹脂(F)が、正の複屈折率の場合、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリビニルアルコール、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、アモルファスポリオレフィン、ポリメチルメタクリレートが用いられ、また負の複屈折率の場合はポリスチレン、フルオレン構造を有する樹脂、例えば、フルオレン構造を有したポリカーボネートやフルオレン構造を有したポリアリレート等が好ましく用いることができる。

【0031】さらに好ましくは、本発明の樹脂との相溶性が良い、ポリカーボネート、ポリアリレートや式

(3)のフルオレン構造を有するポリカーボネート等のブレンドが最も好ましく、また、本発明フィルム樹脂とのブレンド比でR値がコントロールすることができる。

【0032】また高分子ブレンドにするには、樹脂

(E) と樹脂(F) 等の相溶性が重要であり、相溶性が良好な場合は問題ないが、あまり良好でない場合、ブレンド高分子のフィルムは無色、かつ高透過率なフィルムにならない場合がある。このように相溶性が良好でない場合は、モノマー段階で共重合体した方が無色、高透過率のフィルムが得られる。

【0033】またブレンド方法も特に限定されないが、

50

有機溶剤中に何種類の樹脂を溶解させて、樹脂を得る溶液ブレンド法や何種類の樹脂を溶融させてブレンドする溶融ブレンド法が好ましく用いられる。

【0034】負の屈折率異方性を有する負モノマーには、前記式(3)に記載のフルオレン骨格を部分構造に有する構造が用いられ、さらには物質の安定性、製膜性が良好であるフルオレンビスフェノール(FBP、式(9)記載)やビスクレゾールフルオレン(BCF、式(10)記載)の共重合体またはブレンド高分子が最も好ましく用いられる。

【0035】本発明における、式(11)及び式(12)、式(6)及び(7)、式(13)及び式(14)のようなの特性を持つ、本発明の共重合体からなるフィルムのフルオレン骨格成分量は、ビスフェノール成分中の20~90モル%が用いることができるが、更に、位相差特性を考慮すると30~80モル%の範囲が最も好ましく用いられる。また、最適なビスフェノール成分中のフルオレン骨格成分含有量は、式(5)で表すホスホン酸残基(式1記載)とカーボネート残基(式4記載)のモル分率によって異なる。以下に限定されるものでは20ないが例を挙げると、ホスホン酸残基75モル%、カーボネート残基25モル%の場合、フルオレン骨格成分含有量はビスフェノール成分中30~80モル%が好ましく用いられ、式(6)及び式(7)を満たし、かつ大きな波長分散特性が得られる。

【0036】また式(5)で示されるホスホン酸残基のモル分率が75モル%以上になると、ビスフェノール成分中のフルオレン骨格成分を少なく/多くすることで式(6)及び式(7)を満たし、かつ大きな波長分散特性が得られる。また反対に、式(5)で示されるホスホン酸残基のモル分率が75モル%未満の場合はフルオレン骨格成分を多く/少なく含有させることで、式(6)及び式(7)を満足し、かつ大きな波長分散特性が得られる。

【 0 0 3 7 】本発明の位相差フィルムは、波長依存性の 大きいフルオレン骨格成分を有していることから発現し ており、フルオレン骨格成分含有量が 2 0 モル%未満の 時は、大きな波長依存性が発現しない。また、フルオレ ン骨格成分含有量が 9 1 モル%以上の時も、複屈折率異 方性が負になるだけで、大きな波長依存性は発現しな い。

【0038】なお、高R値(R(400nm) /R(550nm))の位相差フィルムのTgは高くなる傾向にあり、分子構造によっては250℃以上を示す。そのため、係るフィルムの延伸時には250℃付近ないしそれ以上の温度に加熱する必要があり、熱劣化等による物性低下や樹脂が着色するなどの問題が生じる。ただし、ディスプレイ用の位相差フィルムにおいては、ある程度耐熱性が必要でありTg100℃以上、より好ましくは120℃以上必要である。

14

【0039】本発明樹脂は、Tgを120℃~240℃の範囲でコントロールできるが、用途に応じて、130~220℃の範囲が好ましく用いられ、最も好ましくは170~205℃で用いられる。

【 O O 4 O 】本発明の位相差フィルムは従来以上に理想 特性に近づいた良好な位相差特性を有する1 / 4 波長板 や、1 / 2 波長板を得ることができる。

【0041】本発明の位相差フィルムは透明であることが好ましく、ヘーズ値 3%以下、全光線透過率は80%以上であることが好ましい。また本発明の位相差フィルムは無色であることが好ましく、黄色度 (Δ Y I) で 2. 0以下であることが好ましく、さらには0.5以下であることが最も好ましい。なお本発明で述べている全光線透過率、ヘーズ値(曇価)とは、日本工業規格J I S K 7105に準じたものである。

【0042】式(1)で表される化合物のリン原子上の 置換基Rの具体例としては、フェニル、ハロ置換フェニ ル、メトキシフェニル、エトキシフェニル、エチル、イ ソプロピル、シクロヘキシル、ビニル、アリル、ベンジ ル、アミノアルキル、ヒドロキシアルキル、ハロ置換ア ルキル、アルキルサルファイド基等が挙げられる。また これら式(1)で表されるホスホン酸残基を構成するホ スホン酸を具体的に例示すると、メチルホスホン酸、エ チルホスホン酸、n-プロピルホスホン酸、イソプロピ ルホスホン酸、nーブチルホスホン酸、イソブチルホス ホン酸、 t — ブチルホスホン酸、 n ーペンチルホスホン 酸、ネオペンチルホスホン酸、シクロヘキシルホスホン 酸、ベンジルホスホン酸、クロロメチルホスホン酸、ジ クロロメチルホスホン酸、ブロモメチルホスホン酸、ジ ブロモメチルホスホン酸、2-クロロエチルホスホン 酸、1、2-ジクロロエチルホスホン酸、2-ブロモエ チルホスホン酸、1、2-ジブロモエチルホスホン酸、 3-クロロプロピルホスホン酸、2、3-ジクロロプロ ピルホスホン酸3ーブロモプロピルホスホン酸、2、3 ージブロモプロピルホスホン酸、2-クロロー1ーメチ ルエチルホスホン酸、1、2-ジクロロー1-メチルエ チルホスホン酸、2-ブロモー1-メチルエチルホスホ ン酸、1、2-ジブロモー1-メチルエチルホスホン 酸、4-クロロブチルホスホン酸、3、4-ジクロロブ チルホスホン酸、4-ブロモブチルホスホン酸、3、4 ージブロモブチルホスホン酸、3-クロロ-1-メチル プロピルホスホン酸、2、3-ジクロロー1-メチルプ ロピルホスホン酸、3-ブロモ-1メチルプロピルホス ホン酸、2、3ージブロモー1ーメチルホスホン酸、1 ークロロメチルプロピルホスホン酸、1ークロロー1ー クロロメチルプロピルホスホン酸、1-ブロモメチルプ ロピルホスホン酸、1-ブロモ-1-ブロモメチルプロ ピルホスホン酸、5-クロロペンチルホスホン酸、4、 5-ジクロロペンチルホスホン酸、5-ブロモペンチル ホスホン酸、4、5ージブロモペンチルホスホン酸、1

ーヒドロキシメチルホスホン酸、2ーヒドロキシエチル ホスホン酸、3ーヒドロキシプロピルホスホン酸、4ー ヒドロキシブチルホスホン酸、5-ヒドロキシペンチル ホスホン酸、1-アミノメチルホスホン酸、2-アミノ エチルホスホン酸、3-アミノプロピルホスホン酸、4 ーアミノブチルホスホン酸、5-アミノペンチルホスホ ン酸、メチルチオメチルホスホン酸、メチルチオエチル ホスホン酸、メチルチオプロピルホスホン酸、メチルチ オブチルホスホン酸、エチルチオメチルホスホン酸、エ チルチオエチルホスホン酸、エチルチオプロピルホスホ ン酸、プロピルチオメチルホスホン酸、プロピルチオエ チルホスホン酸、ブチルチオメチルホスホン酸、フェニ ルホスホン酸、4-クロロフェニルホスホン酸、3、4 ージクロロフェニルホスホン酸、3、5ージクロロフェ ニルホスホン酸、4ーブロモフェニルホスホン酸、3、 4-ブロモフェニルホスホン酸、3、5-ブロモフェニ ルホスホン酸、4-メトキシフェニルホスホン酸、3、 4-ジメトキシフェニルホスホン酸、1-ナフチルホス ホン酸、2-ナフチルホスホン酸、ベンジルホスホン 酸、4-ブロモフェニルメチルホスホン酸、3、4-ジ 20 ブロモフェニルメチルホスホン酸、3、5ージブロモフ ェニルメチルホスホン酸、2-フェニルエチルホスホン 酸、2-(4-ブロモフェニル)エチルホスホン酸、2-(3、4-ジブロモフェニル)エチルホスホン酸、2-(3、5-ジブロモフェニル)エチルホスホン酸、3-フ ェニルプロピルホスホン酸、3-(4-ブロモフェニル) プロピルホスホン酸、3-(3、4-ジブロモフェニル) プロピルホスホン酸、3-(3、5-ジブロモフェニル) プロピルホスホン酸、4-フェニルブチルホスホン酸、 4-(4-ブロモフェニル)ブチルホスホン酸、4-(3、4ージブロモフェニル)ブチルホスホン酸、4ー (3、5-ジブロモフェニル)ブチルホスホン酸、2-ピ リジルホスホン酸、3-ピリジルホスホン酸、4-ピリ ジルホスホン酸、1-ピロリジノメチルホスホン酸、1 ―ピロリジノエチルホスホン酸、1-ピロリジノプロピ ルホスホン酸、1-ピロリジノブチルホスホン酸、ピロ ールー1ーホスホン酸、ピロールー2-ホスホン酸、ピ ロールー3-ホスホン酸、チオフェン-2-ホスホン 酸、チオフェンー3―ホスホン酸、ジチアンー2―ホス ホン酸、トリチアンー2-ホスホン酸、フランー2-ホ 40 スホン酸、フランー3-ホスホン酸、ビニルホスホン 酸、アリルホスホン酸などが挙げられ、またこれらのリ ン原子に2重結合で結合している酸素原子が硫黄原子に 置換されたチオホスホン酸も同様に挙げられる。これら は1種類でも、複数種併用することもできる。

【0043】また、これらホスホン酸はその酸塩化物、 エステル、アミドなどのホスホン酸誘導体であってもよ い。

【0044】これらホスホン酸残基については、それぞ れ対応する3価のリン官能基であるホスホナイト残基に 50 ルフェニル)メタン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフ

16

一部置き換えてもよい。これにより樹脂の耐酸化性を付 与することができるが、光学特性等の特性安定性を考慮 すると、その置換比率は50モル%以下が好ましく、よ り好ましくは25モル%以下、さらに好ましくは10モ ル%以下である。

【0045】また、式(2)で表される2価フェノール 残基を構成する2価フェノールを具体的に例示すると、 1, 1ービス(4ーヒドロキシフェニル)メタン、1, 1ービス(4ーヒドロキシフェニル)エタン、1、1ー ビス (4-メチルー2-ヒドロキシフェニル) メタン、 1、1ービス(3、5ージメチルー4ーヒドロキシフェ ニル)メタン、2、2ービス(4ーヒドロキシフェニ ル) -4-メチルペンタン、1、1-ビス(4-ヒドロ キシフェニル)シクロヘキサン、1,1-ビス(4-ヒ ドロキシフェニル)シクロヘプタン、1、1ービス(4 ーヒドロキシフェニル)シクロオクタン、2、2ービス (4-ヒドロキシフェニル)プロパン、2,2-ビス (3-メチルー4-ヒドロキシフェニル)プロパン、 2, 2-ビス(3, 5-ジメチルー4-ヒドロキシフェ ニル) プロパン、1、1-ビス(4-ヒドロキシフェニ ル) -1-フェニルエタン、1, 1-ビス(4-ヒドロ キシフェニル) -2-エチルヘキサン、2, 2-ビス (3-フェニルー4-ヒドロキシフェニル) プロパン、 1、1-ビス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニル) メタン、4、4'ービフェノール、2、2ービス(4ー ヒドロキシフェニル) ブタン、1、1-ビス(4-ヒド ロキシフェニル) -2-メチルプロパン、1, 1-ビス (4-ヒドロキシフェニル)-1-フェニルメタン、 2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)オクタン、 1、1ービス(3ーメチルー4ーヒドロキシフェニル) シクロヘキサン、2、2ービス(3ーアリルー4ーヒド ロキシフェニル)プロパン、2,2ービス(3ーイソプ ロピルー4ーヒドロキシフェニル)プロパン、2,2-ビス (3-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニ ル) プロパン、2, 2-ビス(3-secブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロパン、ビスフェノールフロー レン、1、1ービス(2ーメチルー4ーヒドロキシー5 ーtertーブチルフェニル)ー2ーメチルプロパン、 4, 4'- [1, 4-フェニレンービス(2-プロピリ デン)] ービス(2ーメチルフェノール)、1, 1ービ ス(3-フェニルー4-ヒドロキシフェニル)シクロへ キサン、4,4'ージヒドロキシフェニルエーテル、 1, 1ービス(2ーヒドロキシフェニル)メタン、2, 4'ーメチレンビスフェノール、1, 1ービス(3ーメ チルー4ーヒドロキシフェニル)メタン、1、1ービス (4-ヒドロキシフェニル)プロパン、1,1-ビス (2-ヒドロキシー5-メチルフェニル)エタン、1、 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-3-メチルーブ タン、1、1ービス(2ーヒドロキシー3、5ージメチ

ェニル) シクロペンタン、1、1ービス(3ーメチルー 4-ヒドロキシフェニル)シクロペンタン、3、3-ビ ス(4-ヒドロキシフェニル)ペンタン、3,3-ビス (3-メチル-4-ヒドロキシフェニル) ペンタン、 3, 3-ビス(3, 5-ジメチル-4-ヒドロキシフェ ニル)ペンタン、2,2ービス(2ーヒドロキシー3, 5ージメチルフェニル)プロパン、2、2ービス(4-ヒドロキシフェニル)ノナン、1、1-ビス(3-メチ ルー4ーヒドロキシフェニル) -1-フェニルエタン、 1. 1ービス(3, 5ージメチルー4ーヒドロキシフェ 10 ニル)シクロヘキサン、2,2ービス(4ーヒドロキシ フェニル)デカン、1、1ービス(4ーヒドロキシフェ ニル) デカン、1、1ービス(2ーヒドロキシー3ー t ertーブチルー5ーメチルフェニル)メタン、1,1 ービス(4ーヒドロキシフェニル)ジフェニルメタン、 テルペンジフェノール、1, 1-ビス(3-tert-ブチルー4ーヒドロキシフェニル)シクロヘキサン、 1. 1-ビス(2-メチルー4-ヒドロキシー5-te rtーブチルフェニル)-2-メチルプロパン、2,2 ービス (3ーシクロヘキシルー4ーヒドロキシフェニ ル) プロパン、1、1ービス(3、5ージtertーブ チルー4ーヒドロキシフェニル) メタン、1、1ービス (3, 5-ジsecブチルー4-ヒドロキシフェニル) メタン、1、1ービス(3ーシクロヘキシルー4ーヒド ロキシフェニル)シクロヘキサン、1、1ービス(2ー ヒドロキシー3、5ージtertーブチルフェニル)エ タン、1、1ービス(3ーノニルー4ーヒドロキシフェ ニル) メタン、2, 2ービス(3, 5ージtertーブ チルー4ーヒドロキシフェニル)プロパン、1、1ービ ス (2-ヒドロキシー3, 5-ジtert-ブチルー6 30ーメチルフェニル)メタン、1,1ービス(3ーフェニ ルー4ーヒドロキシフェニル) - 1 - フェニルエタン、 4, 4ービス(4ーヒドロキシフェニル)ペンタン酸、 ビス(4ーヒドロキシフェニル)酢酸ブチルエステル、 1, 1-ビス(3-フルオロー4-ヒドロキシフェニ ル)メタン、1、1ービス(2ーヒドロキシー5ーフル オロフェニル) メタン、2、2ービス(4ーヒドロキシ フェニル) -1、1、1、3、3、3-ヘキサフルオロ プロパン、2, 2ービス(3ーフルオロー4ーヒドロキ シフェニル) プロパン、1、1-ビス(3-フルオロー 40 4-ヒドロキシフェニル)-1-フェニルメタン、1、 1-ビス(3-フルオロー4-ヒドロキシフェニル)-1-(p-フルオロフェニル)メタン、1, 1-ビス **(4-ヒドロキシフェニル)-1-(p-フルオロフェ** ニル) メタン、2、2ービス(3ークロロー4ーヒドロ キシー5ーメチルフェニル)プロパン、2,2ービス (3、5ージクロロー4ーヒドロキシフェニル)プロパ ン、2、2ービス(3ークロロー4ーヒドロキシフェニ ル)プロパン、1、1ービス(3、5ージブロモー4ー ヒドロキシフェニル)メタン、2,2ービス(3,5-50-4-ヒドロキシフェニル)ペンタデカン、2,2ービ

18

ジブロモー4ーヒドロキシフェニル)プロパン、2.2 ービス(3ーニトロー4ーヒドロキシフェニル)プロパ ン、3、3'ージメチルー4、4'ーピフェノール、3、 3'. 5. 5'ーテトラメチルー4、4'ーピフェノー ル、3, 3', 5, 5'ーテトラtertーブチルー4, 4'ービフェノール、ビス(4ーヒドロキシフェニル) ケトン、3, 3'ージフルオロー4, 4'ービフェノー ル、3、3'、5、5'ーテトラフルオロー4、4'ービ フェノール、ビス(4ーヒドロキシフェニル)ジメチル シラン、ビス(4-ヒドロキシフェニル)スルホン、ビ ス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニル)スルホン、 ピス (3, 5ージメチルー4ーヒドロキシフェニル)ス ルホン、ビス(3、5ージブロモー4ーヒドロキシフェ ニル)スルホン、ビス(4-ヒドロキシフェニル)チオ エーテル、ビス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニ ル) エーテル、ビス(3ーメチルー4ーヒドロキシフェ ニル)チオエーテル、ビス(3,5-ジメチルー4-ヒ ドロキシフェニル) エーテル、ビス (3, 5ージメチル ー4ーヒドロキシフェニル)チオエーテル、1、1ービ ス(2,3,5ートリメチルー4ーヒドロキシフェニ ル) -1-フェニルメタン、2, 2-ビス(4-ヒドロ キシフェニル) ドデカン、2、2-ビス(3-メチルー 4-ヒドロキシフェニル) ドデカン、2, 2-ビス (3, 5-ジメチルー4-ヒドロキシフェニル) ドデカ ン、1、1ービス(3ーtertーブチルー4ーヒドロ キシフェニル) -1-フェニルエタン、1, 1-ビス (3,5-ジtert-ブチルー4-ヒドロキシフェニ ル) -1-フェニルエタン、1、1-ビス(2-メチル - 4 -ヒドロキシー5ーシクロヘキシルフェニル)-2 ーメチルプロパン、1、1ービス(2ーヒドロキシー 3, 5-ジtert-ブチルフェニル) エタン、2, 2 ービス(4ーヒドロキシフェニル)プロパン酸メチルエ ステル、2、2ービス(4ーヒドロキシフェニル)プロ パン酸エチルエステル、イサチンビスフェノール、イサ チンピスクレゾール、2、2'、3、3'、5、5'ーへ キサメチルー4、4'ービフェノール、ビス(2ーヒド ロキシフェニル) メタン、2、4'ーメチレンビスフェ ノール、1、2ービス(4ーヒドロキシフェニル)エタ ン、2-(4-ヒドロキシフェニル)-2-(2-ヒド ロキシフェニル) プロパン、ビス (2-ヒドロキシー3 ーアリルフェニル)メタン、1、1ービス(2ーヒドロ キシー3, 5ージメチルフェニル)-2ーメチルプロパ ン、1、1ービス(2ーヒドロキシー5ーtertーブ **チルフェニル)エタン、ビス(2-ヒドロキシ-5-フ** ェニルフェニル) メタン、1、1-ビス(2-メチルー 4-ヒドロキシー5-tert-ブチルフェニル) ブタ ン、ビス(2ーメチルー4ーヒドロキシー5ーシクロへ キシルフェニル)メタン、2、2ービス(4ーヒドロキ シフェニル)ペンタデカン、2、2ービス(3ーメチル

20

ス(3,5-ジメチルー4ーヒドロキシフェニル)ペン タデカン、1、2-ビス(3,5-ジtert-ブチル -4-ヒドロキシフェニル) エタン、ビス (2-ヒドロ キシー3, 5ージtertーブチルフェニル) メタン、 2, 2-ビス(3-スチリル-4-ヒドロキシフェニ ル)プロパン、1、1ービス(4ーヒドロキシフェニ ル) - 1 - (p - ニトロフェニル) エタン、ビス (3, 5-ジフルオロー4-ヒドロキシフェニル)メタン、ビ ス(3,5ージフルオロー4ーヒドロキシフェニル)ー 1-フェニルメタン、ビス(3,5-ジフルオロー4-ヒドロキシフェニル)ジフェニルメタン、ビス(3-フ ルオロー4ーヒドロキシフェニル)ジフェニルメタン、 2, 2ーピス(3ークロロー4ーヒドロキシフェニル) プロパン、3, 3', 5, 5'-テトラtert-ブチル-2, 2'-ビフェノール、2, 2'-ジアリル-4, 4'ービフェノール、1、1ービス(4ーヒドロキシフ ェニル) -3, 3, 5-トリメチルーシクロヘキサン、 1, 1ービス(4ーヒドロキシフェニル) -3, 3, 5, 5ーテトラメチルーシクロヘキサン、1, 1ービス (4-ヒドロキシフェニル) -3, 3, 4-トリメチル ーシクロヘキサン、1、1ービス(4ーヒドロキシフェ ニル)-3,3-ジメチル-5-エチル-シクロヘキサ ン、1, 1ービス(4ーヒドロキシフェニル)ー3, 3, 5-トリメチルーシクロペンタン、1, 1-ビス (3, 5ージメチルー4ーヒドロキシフェニル)ー3/ 3,5-トリメチルーシクロヘキサン、1,1-ビス (3, 5ージフェニルー4ーヒドロキシフェニル)ー 3, 3, 5ートリメチルーシクロヘキサン、1, 1ービ ス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニル)-3,3, 5ートリメチルーシクロヘキサン、1、1ービス(3ー フェニルー4ーヒドロキシフェニル) -3, 3, 5-ト リメチルーシクロヘキサン、1、1ービス(3、5ージ クロロー4ーヒドロキシフェニル)-3,3,5ートリ メチルーシクロヘキサン、9、9ービス(4ーヒドロキ シフェニル) フルオレン、9、9ービス(3,5ージメ チルー4ーヒドロキシフェニル) フルオレン、1、1-ビス(3,5-ジブロモー4-ヒドロキシフェニル)ー 3, 3, 5-ス(4ーヒドロキシフェニル)-1、4-ジイソプロピ ルベンゼン等が挙げられ、これらは1種類でも、複数種 40 併用することもできる。これら2価フェノールは得られ るポリマーの性能に応じて用いることができる。また、 これら2価フェノールはフルオレン骨格を有する成分の モノマーと組合せて用いてもよい。

【0046】また、ジヒドロキシベンゼンを本発明の効 果が損なわれない範囲で用いることができ、これらジヒ ドロキシベンゼンとしては、レゾルシノール、ハイドロ キノン、1、2-ジヒドロキシベンゼン等が挙げられ、 これらは1種類でも、複数種併用することもできる。 【0047】また、式(4)の繰り返し単位であるカー 50 ボネート残基とは、炭酸エステル、炭酸ハライドなどを 原料として得られる構造単位であり、例えばジフェニル カーボネート、ジトリールカーボネート、ビス(クロロ フェニル)カーボネート、mークレジルカーボネート、 ジナフチルカーボネート、ビス(ジフェニル)カーボネ ート、ジエチルカーボネート、ジメチルカーボネート、 ジブチルカーボネート、ジシクロヘキシルカーボネー ト、ジシクロヘキシルカーボネートなどの炭酸エステ ル、ホスゲン、トリホスゲンなどの炭酸ハライドが挙げ られる。

【〇〇48】また、本発明の位相差板に用いる高分子配 向フィルムは必ずしも直鎖状である必要はなく、得られ るポリマーの性能に応じて多価フェノールを共重合する ことができる。このような多価フェノールを具体的に例 示すると、トリス (4-ヒドロキシフェニル) メタン、 4, 4'- [1-[4-[1-(4-ヒドロキシフェニ ル) -1-メチルエチル] フェニル] エチリデン] ビス フェノール、2、3、4、4'ーテトラヒドロキシベン ゾフェノン、4ー〔ビス(4ーヒドロキシフェニル)メ チル] -2-メトキシフェノール、トリス(3-メチル -4-ヒドロキシフェニル) メタン、4-〔ピス(3-メチルー4ーヒドロキシフェニル)メチル]ー2ーメト キシフェノール、4ー〔ビス(3, 5ージメチルー4ー ヒドロキシフェニル)メチル].-2-メトキシフェノ.-ル、1、1、1ートリス(4ーヒドロキシフェニル)エ タン、1、1、1ートリス(3ーメチルー4ーヒドロキ シフェニル)エタン、1、1、1ートリス(3、5ージ メチルー4ーヒドロキシフェニル)エタン、トリス(3) ーメチルー4ーヒドロキシフェニル)メタン、トリス (3, 5ージメチルー4ーヒドロキシフェニル) メタ ン、2、6ービス〔(2ーヒドロキシー5ーメチルフェ ニル)メチル]ー4ーメチルフェノール、4ー[ビス (3, 5-ジメチルー4ーヒドロキシフェニル)メチ ル] -1, 2-ジヒドロキシベンゼン、2-[ピス(2 ーメチルー4ーヒドロキシー5ーシクロヘキシルフェニ ル)メチル]ーフェノール、4ー[ビス(2-メチルー 4-ヒドロキシー5-シクロヘキシルフェニル) メチ ル] -1, 2-ジヒドロキシベンゼン、4-メチルフェ ニルー1, 2, 3ートリヒドロキシベンゼン、4ー 〔(4-ヒドロキシフェニル)メチル〕-1,2,3-トリヒドロキシベンゼン、4-[1-(4-ヒドロキシ フェニル) -1-メチル-エチル] -1, 3-ジヒドロ キシベンゼン、4-[(3,5-ジメチル-4-ヒドロ キシフェニル) メチル] -1, 2, 3-トリヒドロキシ ベンゼン、1、4ービス〔1ービス(3、4ージヒドロ キシフェニル) -1-メチル-エチル] ベンゼン、1, 4ービス〔1ービス(2,3,4ートリヒドロキシフェ ニル) - 1 - メチルーエチル] ベンゼン、2, 4 - ビス 〔(4-ヒドロキシフェニル)メチル〕-1、3-ジヒ ドロキシベンゼン、2-〔ビス(3-メチル-4-ヒド

ロキシフェイル) メチル] フェノール、4 - 〔ビス(3 ーメチルー4ーヒドロキシフェイル) メチル〕フェノー ル、2-〔ビス(2-メチル-4-ヒドロキシフェイ ル)メチル]フェノール、4ー〔ビス(3ーメチルー4 ーヒドロキシフェニル) メチル】 - 1、2 - ジヒドロキ シベンゼン、4ー [ビス(4ーヒドロキシフェニル) メ チル] -2-エトキシフェノール、2-[ビス(2, 3 ージメチルー4ーヒドロキシフェニル) メチル〕フェノ ール、4ー〔ビス(3、5ージメチルー4ーヒドロキシ フェニル) メチル] フェノール、3ー〔ビス(3,5ー ジメチルー4ーヒドロキシフェニル)メチル)フェノー ル、2ー〔ビス(2ーヒドロキシー3、6ージメチルフ ェニル)メチル]フェノール、4-〔ビス(2ーヒドロ キシー3、6-ジメチルフェニル)メチル]フェノー ル、4ー〔ビス(3、5ージメチルー4ーヒドロキシフ ェニル)メチル]ー2ーメトキシフェノール、3,6ー 〔ビス(3,5ージメチルー4ーヒドロキシフェニル) メチル] - 1、2 - ジヒドロキシベンゼン、4、6 -[ビス(3,5ージメチルー4ーヒドロキシフェニル) メチル] -1, 2, 3-トリヒドロキシベンゼン、2-[ビス(2,3,6ートリメチルー4ーヒドロキシフェ ニル)メチル)フェノール、2- [ビス(2, 3, 5-トリメチルー4ーヒドロキシフェニル) メチル〕フェノ ール、3-〔ビス(2,3,5-トリメチルー4-ヒド ロキシフェニル) メチル] フェノール、4ー〔ビス (2, 3, 5-トリメチルー4-ヒドロキシフェニル) メチル] フェノール、4ー〔ビス(2、3、5ートリメ チルー4ーヒドロキシフェニル) メチル] ー1、2ージ ヒドロキシベンゼン、3-〔ビス(2-メチル-4-ヒ ドロキシー5-シクロヘキシルフェニル) メチル] フェ ノール、4-〔ビス(2-メチル-4-ヒドロキシ-5 ーシクロヘキシルフェニル)メチル〕フェノール、4-[ビス(2-メチルー4-ヒドロキシー5-シクロヘキ シルフェニル) メチル] ー2ーメトキシフェノール、 2, 4, 6- [トリス (4-ヒドロキシフェニルメチ ル) -1、3-ジヒドロキシベンゼン、1、1、2、2 ーテトラ (3ーメチルー4ーヒドロキシフェニル) エタ ン、1、1、2、2ーテトラ(3、5ージメチルー4ー ヒドロキシフェニル)エタン、1,4-〔〔ビス(4-ヒドロキシフェニル)メチル〕〕 ベンゼン、1、4ージ 〔ビス(3ーメチルー4ーヒドロキシフェニル)メチ ル】ベンゼン、1、4ージ〔ビス(3、5ージメチルー 4~ヒドロキシフェニル) メチル] ベンゼン、4~ [1, 1ービス(4ーヒドロキシフェニル)エチル]ア ニリン、(2,4ージヒドロキシフェニル)(4ーヒド ロキシフェニル)ケトン、2-〔ビス(4-ヒドロキシ フェニル) メチル) フェノール、1、3、3ートリ(4 ーヒドロキシフェニル)ブタン等が挙げられ、これらは 1種類でも、複数種併用することもできる。

【0049】また、本発明に用いる高分子配向フィルム 50 ベンジルアルコール、イソホロン、クロロベンゼン、ジ

22

を構成する樹脂においては、式(5)を満足することが 必要である。

[0050]

 $1 \ge (a) / [(a) + (b)] \ge 0.05$ 本発明の位相差板に用いられる高分子配向フィルムを構 成する樹脂の製造方法としては、酸ハライドと2価のフ ェノールを有機溶剤中で反応させる溶液重合法(A. C onix Ind. Eng. chem., 51, 1959年、特公昭37-5599号公報)、酸 ハライドと2価のフェノールを塩化マグネシウム等の触 媒存在下で加熱する溶融重合法、2価の酸と2価のフェ ノールをジアリルカーボネートの存在下で加熱する溶融 重合法(特公昭38-26299号公報)、水と相溶し ない有機溶剤に溶解せしめた2価の酸ハライドとアルカ リ水溶液に溶解せしめた2価のフェノールとを混合する 界面重合法(W. M. EARECKSON J. Pol y. Sci., XL399, 1959年、特公昭40 -1959号公報)等が挙げられるが、特に溶液重合法 が好適に採用される。溶液重合法について一例を説明す ると、ホスホン酸残基の前駆体分子であるホスホン酸誘 導体と、2価フェノールをトリエチルアミンなどの塩基 存在下混合して反応させ、続いてカーボネート残基の前 駆体分子、たとえばトリホスゲンなどを添加して縮合重 合することによって本発明の樹脂を得ることができる。 ホスホン酸誘導体あるいはカーボネート誘導体としては それらのハロゲン化物、酸無水物、エステル等が用いら れるが特に限定されない。

【0051】本発明の位相差板に用いられる高分子配向フィルムに用いる樹脂の分子量を調節する方法としては、重合時に一官能の物質を添加して行うことができる。ここで言う分子量調節剤として用いられる一官能物質としては、フェノール、クレゾール、p-tertーブチルフェノール等の一価フェノール類、安息香酸クロライド、メタンスルホニルクロライド、フェニルクロロホルメート等の一価酸クロライド類が挙げられる。

【0052】本発明の位相差板に用いられる高分子配向フィルムに用いる樹脂は、その特性を損なわない範囲で、ヒンダードフェノール系、ヒンダードアミン系、チオエーテル系、燐系の各種抗酸化剤を添加することができる。更にフェニルサリチル酸、2ーヒドロキシベンゾフェノン、トリフェニルホスホネートなどの紫外線吸収剤や、ブルーイング剤、酸化防止剤等を添加しても良い。

【0053】本発明の位相差板に用いられる高分子配向フィルムの樹脂は、有機溶媒に対して高い溶解性を有しており、このような溶媒としては、塩化メチレン、クロロホルム、1、1、2、2ーテトラクロロエタン、1、2ージクロロエタン、テトラヒドロフラン、1、4ージオキサン、トルエン、キシレン、アーブチロラクトン、ベンジルアルコール、イソホロン、クロロベンゼン、ジ

20

30

クロロベンゼン、ヘキサフルオロイソプロパノール等が 挙げられる。さらに、本発明のポリマーは非晶性であ り、非晶性であるかどうかは、公知の方法例えば示差走 差熱量分析(DSC)や動的粘弾性測定等により融点が 存在しているかどうかを確認すればよい。従って、溶液 製膜法が好適に採用しうる。

【〇〇54】一般に高分子配向フィルムとは無配向の高 分子フィルムを1軸以上に延伸したフィルムであり、あ る任意の配向方向とその直交方向に屈折率差を生じさせ たフィルムである。位相差とは、膜厚dとフィルムの配 向方向とその直交方向との屈折率差(Δn:複屈折率) との積である∆n・dとして定義される。本発明におい て配向とは、高分子分子鎖が特定の方向に並ぶ傾向を言 い、通常光の波長550nmで位相差が15nm以上で あることを言う。高分子配向フィルムの面内における配 向方向の屈折率がその直交方向の屈折率より大きい場合 を光学的異方性が正といい、反対に配向方向の屈折率が その直交方向の屈折率より小さい場合はを光学的異方性 が負という。位相差は絶対値であらわすこともあるが、 光学異方性が負の場合には位相差は負の値を有してい る。本発明では特にことわりのない限りは絶対値で説明 する。

【0055】一般に位相差板とは1枚の高分子配向フィルムからなるものと2枚以上の積層体からなる位相差フィルムからなるものとがあるが、本発明の位相差フィルムはどちらにでも用いることができる。本発明の位相差フィルムと波長依存性の異なる下記したような高分子配向フィルムと積層させることによって測定波長が短いほど位相差が小さくなる理想的な特性を得ることができる。具体的にはポリスチレン、ポリアリレート、シクロオレフィン、ポリカーボネート、ポリビニルアルコール、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、アモルファスポリオレフィン等が挙げらる。

【0056】一般に高分子配向フィルムとは無配向の高 分子フィルムを1軸以上に延伸したフィルムであり、あ る任意の配向方向とその直交方向に屈折率差を生じさせ たフィルムである。位相差とは、膜厚dとフィルムの配 向方向とその直交方向との屈折率差(Δn:複屈折率) との積である∆n・d (レタデーション値)として定義 される。本発明の位相差フィルムはR値(R(400n 40 m) /R (550nm)) が大きいことから、アモルフ ァスオレフィンフィルムやポリビニルアルコールフィル ム等の異種樹脂と積層させるような位相差板の場合、本 発明の位相差フィルムのΔn・dが低くても、1/4波 長特性が得られるので、該フィルムと積層される異種樹 脂フィルム等のΔn・dも低くすることができる。その 結果、膜厚dを薄くする事も可能であり、または延伸倍 率を下げ、Δηを小さくしても1/4波長位相差特性を 得ることができる。これらの優れる点は、△nを下げる ため、配向度(延伸度)を弱めて、配向ムラを改善した 50 24

り、または膜厚 d を下げて薄膜化する事も可能になる。 また分子構造によっては、主鎖に高屈折率成分を含有させることが可能である。このような樹脂は僅かな配向で も複屈折しやすく位相差が発現しやすい傾向があるため、更に配向度(延伸度)を下げることができる。

【0057】近年、位相差板を工業的に製造する際には、2枚のフィルムを直交に積層し、光学主軸を直交させることが行われている。だが、本発明の負の複屈折率異方性を持つ位相差フィルムは、正の複屈折率をもつフィルムと積層させる時、巻回しているフィルムロールから連続的に積層しても、光学的主軸(屈折率楕円体の長軸方向)は直交方向なため、工程削減、コストダウンすることもできる。本発明では特にことわりのない限りは絶対値で説明する。

【0058】本発明の位相差フィルムは透明であることが好ましく、ヘーズ値3%以下、全光線透過率は80%以上であることが好ましい。

【0059】本発明の位相差フィルムの製造方法として公知の溶融押出法、溶液キャスト法等が用いられるが、膜厚ムラ、配向状態の観点から溶液キャスト法が好ましく用いられる。また延伸方法も公知の延伸方法が採用し得、一軸ないし多軸の延伸が採用しうるが、縦1軸延伸であることが好ましい。延伸性向上の目的で、公知の可塑剤であるフタル酸ジブチル、フタル酸ジメチル、フタル酸ジエチルなどのフタル酸エステル、トリブチルホネートなどのリン酸エステル、トリブチルホスホネートなどのリン酸エステル、脂肪族2塩基エステル、グリセリン誘導体、ポリエチレングリコールなどのグリコール誘導体が含有されてもよい。また、可塑剤等は位相差特性にも少なからず影響を与えるためポリマーは位相差特性にも少なからず影響を与えるためポリマー固形分比10重量%以下であることが最も好ましい。

【 O O 6 O 】 延伸時には、フィルム製膜時に用いた有機溶剤を残留させたまま延伸してもよい。なおこの時の溶剤残存率は 1 ~ 2 O 重量%範囲であることが好ましい。位相差フィルムの膜厚は特に限定されるものではないが 1 μ m ~ 5 O O μ m であることが好ましい。なお本発明は位相差フィルムと表現しているが、シート等も含む意味で用いている。

【0061】本発明の位相差板は、構成される複数枚の位相差フィルムの位相差、及び波長依存性を調整することによって、波長依存性が理想に近い良好な 1/4 波長板や 1/2 波長板を構成する事もできる。なお、 1/4 波長板の場合は $80 \text{ nm} \leq \text{R}(550 \text{ nm}) \leq 180 \text{ nm}$ であることが好ましく、より好ましくは $100 \text{ nm} \leq \text{R}(550 \text{ nm}) \leq 160 \text{ nm}$ である。また 1/2 波長板の場合は $220 \text{ nm} \leq \text{R}(550 \text{ nm}) \leq 320 \text{ nm}$ であることが好ましく、より好ましくは $250 \text{ nm} \leq \text{R}(550 \text{ nm}) \leq 300 \text{ nm}$ である。また、本発明の位相差板、円偏光板は反射型液晶表示装置や有機電界表示装置などに用いることが可能である。

30

【0062】また本発明の位相差フィルムを以下の構成 にすることで位相差板、円偏光板、楕円偏光板を得るこ とができる。ここに例を挙げると波長550nmで21 2. 5 nmの位相差を持つシクロオレフィン配向フィル ムと波長550nmで75nmの位相差を持つR値が 1. 5である本発明の位相差フィルムを粘着層、接着層 を介して光学的主軸(屈折率楕円体の長軸方向)を直交 に積層させたものを位相差板(1/4波長板)とする。 このように得られた位相差板の面内屈折率楕円体の長軸 方向に対して、45度方向に偏光軸を持つように偏光フ ィルムを積層した位相差板を円偏光板と呼ぶ。得られた 円偏光板は偏光板側から光を入射させると広帯域で円偏 光化することができる。また、位相差板の位相差を 1/ 3波長や1/5波長にしたり、積層角度を任意の角度に することで楕円偏光板を得ることもできる。なお、円偏 光板、楕円偏光板の構成はこれに限定されるものではな い。

[0063]

【実施例】本発明の具体的実施態様を以下に実施例をもって述べるが、本発明はこれに限定されるものではない。

【0064】実施例1

窒素雰囲気下、塩化メチレン(40ml)中にメチルベン ジリデンビスフェノール(44mmol)、9,9ービス - (4-ヒドロキフェニル) フルオレン(36mmol) およびトリエチルアミン(168mmol)を混合し、氷 冷下攪拌した。(80mmol)、およびトリエチルアミ ン(168mmol)を混合し、氷冷下攪拌した。この溶 液にフェニルホスホン酸ジクロライド(60mmol)の 塩化メチレン(10ml)溶液を15分間かけて滴下し、 滴下終了後室温で60分間攪拌した。その後、濃度0. 584 bmo l / l であるトリホスゲンの塩化メチレン 溶液(11.41ml)を15分かけて滴下し、滴下終了 後60分間攪拌した。その後、反応溶液をエタノール2 OOOm I に投入して再沈し、ポリマーを濾取した後、 (1)エタノール1000m I (2)水/エタノール=1/ 1混合溶液1000ml(3)水1000mlの順で生成 したポリマーを洗浄、乾燥して目的の樹脂粉末を収率9 0%で得た。

【0065】得られた樹脂粉末をDSC(セイコー電子工業(株)製:SSC5200)にてガラス転移温度を測定した。また、得られた樹脂粉末は下記に示す方法で高分子配向フィルム化し位相差特性評価した。すなわち溶液キャスト製膜の場合は、塩化メチレンに溶解させ、ポリマー固形分濃度15wt%のドープ溶液を作製した。このドープ溶液をガラス板上に製膜、乾燥させることによってキャストフィルムを得た。得られたキャストフィルムを温度200℃で2.0倍に幅方向自由1軸延伸し、位相差フィルムを得た。延伸時のフィルム幅と延伸方向の延伸前の長さの比は1:1とした。得られたフ

26

ィルムの位相差測定はセルギャップ検査装置(大塚電子 (株) 製:RETS-1100) を用いて、各光の波長 の位相差を測定した。屈折率異方性の確認は、レタデー ションが80~200nm以下の場合、直交に積層され た2枚の偏光板の間に得られたフィルムの延伸軸を45 。 方向に積層させ、その上にあらかじめ屈折率異方性が 正だとわかっている位相差50nmのポリカーボネート 製の位相差フィルムを45°にて積層させて光を透過さ せる。その光が明るくなったら得られたフィルムは屈折 率異方性は正であり、暗ければその得られたフィルムは 屈折率異方性は負である。反対に、ポリカーボネートに 代わってあらかじめ屈折率異方性が負だとわかっている ポリスチレン製の位相差フィルムを45°方向に積層さ せて光を透過させた場合は、その光が明るくなったら得 られたフィルムは屈折率異方性は負であり暗くなれば、 その得られたフィルムは屈折率異方性は正である。

【0066】実施例2

窒素雰囲気下、塩化メチレン(40ml)中にメチルベン ジリデンビスフェノール(30.4mmol)、9,9-ビスー(4ーヒドロキフェニル)フルオレン(49.6 mmol)およびトリエチルアミン(168mmol)を 混合し、氷冷下攪拌した。この溶液にフェニルホスホン 酸ジクロライド(60mmol)の塩化メチレン(10m 1)溶液を15分間かけて滴下し、滴下終了後室温で6 O分間攪拌した。その後、濃度 O. 584 mol/I であるト リホスゲンの塩化メチレン溶液(11.41ml)を15 分かけて滴下し、滴下終了後60分間攪拌した。その 後、反応溶液をエタノール2000mlに投入して再沈 し、ポリマーを濾取した後、(1)エタノール1000m I(2)水/エタノール=1/1混合溶液1000ml (3)水1000mlの順で生成したポリマーを洗浄、乾 燥して目的の樹脂粉末を収率88%で得た。つづいて延 伸温度を210℃、延伸倍率を1.7倍にした以外は、 実施例1と同様の方法で配向フィルム化して評価した。 【0067】実施例3

窒素雰囲気下、塩化メチレン(40ml)中に1,1ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン(36mmol)、9,9ービスー(4ーヒドロキフェニル)フルオレン(44mmol)およびトリエチルアミン(168mmol)を混合し、氷冷下攪拌した。この溶液にフェニルホスホン酸ジクロライド(60mmol)の塩化メチレン(10ml)溶液を15分間かけて滴下し、滴下終了後室温で60分間攪拌した。その後、濃度0.584mol/Iであるトリホスゲンの塩化メチレン溶液(11.41ml)を15分かけて滴下し、滴下終了後60分間攪拌した。その後、反応溶液をエタノール2000mlに投入して再沈し、ポリマーを濾取した後、(1)エタノール1000ml(2)水/エタノール=1/1混合溶液100ml(3)水1000mlの順で生成したポリマーを洗浄、乾燥して目的の樹脂粉末を収率85%で得た。つ

づいて延伸温度を200℃、延伸倍率を2.0倍にした 以外は、実施例1と同様の方法で配向フィルム化して評価した。

【0068】 実施例 4

窒素雰囲気下、塩化メチレン(40m1)中にビスフェノ ールA(24mmol)、9.9ービスー(4ーヒドロキ フェニル) フルオレン(56mmol)およびトリエチル アミン(168mmol)を混合し、氷冷下攪拌した。こ の溶液にフェニルホスホン酸ジクロライド(60mmo I)の塩化メチレン(10mI)溶液を15分間かけて滴 下し、滴下終了後室温で60分間攪拌した。その後、濃 度 0.584 mo 1/1であるトリホスゲンの塩化メチ レン溶液(11.41ml)を15分かけて滴下し、滴下 終了後60分間攪拌した。その後、反応溶液をエタノー ル2000mlに投入して再沈し、ポリマーを濾取した 後、(1)エタノール1000ml(2)水/エタノール= 1/1混合溶液1000ml(3)水1000mlの順で 生成したポリマーを洗浄、乾燥して目的の樹脂粉末を収 率85%で得た。つづいて延伸温度を215℃、延伸倍 率を1. 7倍にした以外は、実施例1と同様の方法で配 20 向フィルム化して評価した。

【0069】比較例1

市販されているポリカーボネート: "タフロンA 2 2 0 0"(出光石油化学(株)製)を用いて、延伸温度を 1 5 0℃、延伸倍率を 1.4倍にした以外は、実施例 1 と同様の方法で配向フィルム化して評価した。

【0070】比較例2

市販されているポリアリレート: "Uポリマー"(ユニチカ(株)製)を用いて、延伸温度を195℃、延伸倍率を1.1倍にした以外は、実施例1と同様の方法で配向フィルム化して評価した。実施例1~4と比較例1~2の方法で作成した配向フィルムの評価結果を行った。結果を表1に示す。

[0071]

【表1】

		実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	比較例1	比較例2
ガラス転移温度(Tg)	(၁့)	188	198	182	200	141	193
R(400)	(nm)	180.51	191.48	102.49	143.58	193.38	177.41
R(550)	(nm)	143.81	130.32	76.13	110.47	169.85	150.62
R(700)	(nm)	128.05	104.04	69.54	96.24	159.76	139.11
R(400)/R(550)		1.255	1.469	1.290	1.300	1.139	1.178
R(650)/R(550)		0.890	0.798	0.875	0.871	0.941	0.924
屈折率異方性		王	負	負	負	正	田

28

[0072]

【発明の効果】本発明により高R値(R(400nm) /R(550nm))を持つ、優れた位相差特性を有した位相差フィルムが提供でき、この位相差フィルムと偏 光板を組み合わせた円偏光板等にして、さらに高速応答 性の液晶セルを用いる液晶表示分野等にも使用できる。 この位相差フィルムは各種分野に用いることができる。

フロントページの続き

F ターム(参考) 2H049 BA06 BB44 BB50 BC03 BC09 2H091 FA11X FA11Z FB02 FD10

FD24 LA03 LA16 LA17 LA20

LA30

4J029 AA09 AB01 AB07 AD10 AE04

BB08 BB11 BD01 BH02 DB02

DB11 DC02 HA01 HC01 HC05

JC54 JC57 KE05

10

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.